

Preparation of Ta-doped TiO₂ thin films by co-sputtering and their photo-electrode properties

Jong-Won Yoon[†]

Department of Advanced Materials Science and Engineering, Dankook University, Cheongan-si, Chungnam 330-714, Korea

(Received August 1, 2008)

(Accepted August 12, 2008)

Abstract Ta-doped thin films were deposited on quartz and indium-tin oxide glass substrates using a co-sputtering method. The Ta-doped films formed a solid solution that induced structural changes from rutile to anatase phase. The anodic photocurrents of the Ta-doped TiO₂ electrodes were observed not only in UV but also in the visible light range. The photocurrent response in visible light on Ta-doped TiO₂ films are due to bandgap reduction.

Key words TiO₂, Ta, Thin films, co-sputtering, XRD, FE-SEM, XPS, Photocurrent

동시스퍼터법에의한 Ta 도핑된 TiO₂ 박막 합성과 광전극 특성

윤종원[†]

단국대학교 신소재공학과, 충남, 330-714

(2008년 8월 1일 접수)

(2008년 8월 12일 심사완료)

요약 동시스퍼터법을 이용하여 Ta이 도핑된 TiO₂ 박막을 석영 및 ITO 기판위에 제작하였다. Ta의 도핑량은 동시스퍼터법에 의하여 조절되는 Ta 금속선 길이에 의하여 제어 되었다. Ta이 도핑된 TiO₂ 박막은 rutile상에서 anatase상으로 구조변화를 유발 시키며 고용체를 형성했다. Ta의 도핑량이 증가함에 따라 rutile상 보다는 anatase상이 많은 것으로 나타났다. XPS 분석에 따르면 도핑된 Ta은 금속이 아닌 Ta₂O₅의 산화물을 형성하는 것으로 나타났다. Ta이 도핑된 TiO₂ 전극에서는 자외선(UV) 영역을 포함하여 가시광(VIS) 영역의 빛의 조사에 광전류응답 특성을 발현하였다. 가시광선 영역에서 발현된 광전류 응답 특성은 Ta 도핑에 의하여 TiO₂ 밴드갭내에 불순물 준위의 형성에 기인한 것으로 사료된다.

1. 서 론

반도체나 금속으로 도핑된 나노컴포지트(nanocomposite)는 3차원 비선형 광학 효과(third-order nonlinear optical effects), Photoluminescence, 그리고 광촉매효과와 같은 독특한 광특성 때문에 널리 연구가 되어왔다[1-3]. 이와 같은 독특한 특성은 나노파티클과 산화물 기반(matrix) 계면에서 일어나는 현상 때문에 일어난다. 나노컴포지트를 디자인 하는 주요한 목적 중 하나는 촉매로서의 특성을 향상 시키려는 것이다. 예를 들면 단일성분으로 구성된 반도체 나노파티클(single-componentnt semiconductor nanoparticles)은 광에 의해 생성된 전하운반자(charge carrier)의 대부분이 재결합되기 때문에 상

대적으로 낮은 광촉매효율을 나타낸다[4]. 반도체-반도체 또는 반도체-금속 컴포지트 파티클은 이 시스템에서 전하의 정류(charge rectification)를 촉진한다. 반도체 나노파티클 위의 귀금속(noble metal)의 중착은 광촉매 반응의 효율을 극대화하기 위해서 필수적인 요소이다[5]. 앞선 연구에서 본 연구자는 RF magnetron 동시스퍼터(co-sputtering)법을 이용해서 M/TiO₂(M = Au, Pt) 나노 컴포지트 박막을 성공적으로 합성하였다. 더욱이, 나노 컴포지트 전극은 자외선(UV)영역에서부터 가시광선(VIS) 영역의 범위까지 광응답 특성을 보여주었다[6-8]. 가시광선영역으로의 광응답 특성을 확장하기 위한 다른 방법은 TiO₂ 도핑물질을 첨가 하여 고용체(solid solution)를 제작하는 것으로서 좁은 밴드갭을 갖는 광전극을 제작하는 것이다. 그러나 Nb 또는 Fe와 같은 불순물(impurity)을 가지고 도핑된 TiO₂ 박막을 합성하는 극소수의 시도에도 불구하고 이러한 물질의 도핑에 따른 가시광 영역의 빛에 대한 광응답 특성을 발현한 정보가 거의 없다[9]. 5가의

[†]Corresponding author

Tel: +82-41-550-3536

Fax: +82-41-550-3536

E-mail: jwyo@dankook.ac.kr

탄탈륨(pentavalent tantalum)은 광응답 특성을 가시광선 까지 확장시킬 수 있는 가능한 도판트(dopant) 중의 하나이다. 그러나 탄탈륨 성분은 입계(grain boundary)에서 분리(segregate) 되는 경향이 있고 일반적으로 균질한(homogeneous) 도핑이 어렵다.

본 연구에서는 동시 스퍼터법을 이용하여 탄탈륨이 도핑된 TiO_2 (Ta-doped TiO_2) 박막의 제작 및 캐릭탈리제 이션을 수행 하였고 제작된 박막에 대한 광전극 특성을 검토해 보았다. 특히 동시스퍼터법으로 제작된 전이금속이 도핑된 TiO_2 박막의 제작 및 가시광선 영역에서 광전류 특성의 검토 및 그 원인 규명에 대한 연구는 본 연구에서 처음으로 시도되었다.

2. 실험 방법

동시스퍼터법(co-sputtering)에 의하여 Ta^{+} 도핑된 TiO_2 박막을 수정(quartz glass) 또는 ITO 기판 위에 제작 하였다. 이때 가스는 Ar가스를 이용하였고 압력은 0.53 Pa을 유지시켜 주었다. RF 파워는 100 W이었다. Ta 금속의 양을 조절하기 위해 지름이 100 mm인 TiO_2 타겟위에 지름이 0.5 mm인 Ta 금속선을 대칭적으로 올려 주었다. 증착시간은 2시간이었다. 증착 후 박막은 600°C의 대기 분위기에서 열처리 하였다. 표면모포로지는 전계방출전자현미경(field-emission scanning electron microscopy, FE-SEM, Hitachi S-4800)으로 관찰되었다. 박막의 두께는 표면 단면 측정 시스템(surface profile measuring system, Alpha step 300)으로 측정되었다. Ta 이 도핑된 TiO_2 박막의 상분석은 (Phase identification)은 $\text{Cu K}\alpha$ X-ray 소스를 사용하는 X-ray 회절기(X-ray diffractometer, XRD, Rigaku RAD-C)을 이용하여 수행되었다. 박막의 표면의 성분과 화학상태는 X선광전자분광기(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS, PHI 5600ci)에 의해 측정되었다. 결합에너지(binding energy) 값은 284.5 eV에서의 탄소의 C1s를 가지고 보정되었다.

3. 결과 및 고찰

Fig. 1은 동시스퍼터법에 의해 합성된 Ta^{+} 도핑된 TiO_2 박막의 XRD 패턴을 나타내고 있다. 순수 TiO_2 및 Ta^{+} 도핑된 펄름에서 anatase 및 rutile상의 혼성이 나타났으며 anatase상의 비율은 Ta/Ti의 비율 0.06, 0.14, 0.16에 따라서 72%, 85%, 92%로 나타났다. 따라서 Ta의 도핑량의 증가에 따라 rutile상에서 anatase상으로 구조 변화를 일으키는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 Nb⁺ 도핑된 결과와 같은 경향을 나타내고 있다[9].

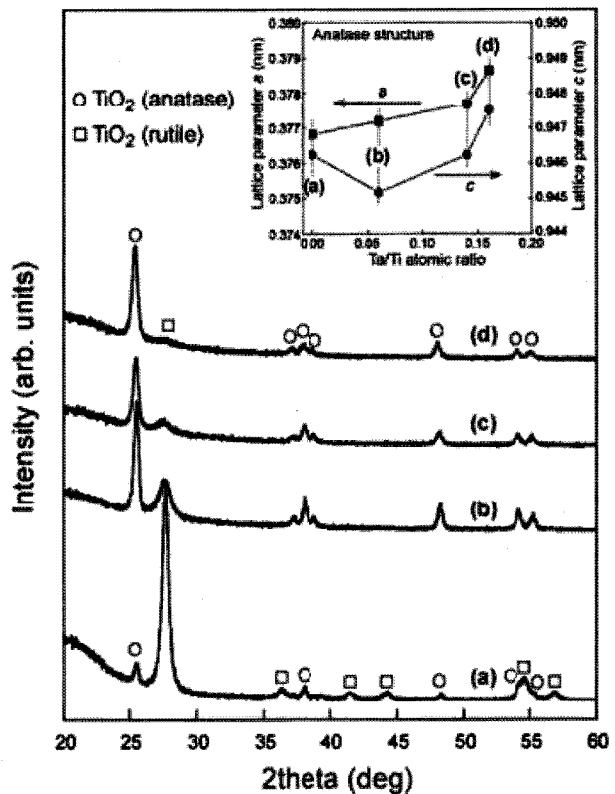


Fig. 1. XRD patterns of Ta-doped TiO_2 thin films heated in air 600°C for 1 h; (a) pure TiO_2 , (b)~(d) samples prepared with Ta/Ti atomic ratios of 0.06, 0.14, 0.16. The inset represents lattice parameter a and c as a function of Ta/Ti ratio.

또한 Ta의 도핑량에 따른 a 축 및 c 축의 격자상수 변화를 Fig. 1의 오른쪽 상부에 삽입되어 나타내고 있다. Ta의 도핑량에 따라서 a 축 및 c 축 방향으로 격자 상수가 증가하는 경향을 나타내고 있는데 이는 6배 위의 경우 Ta의 이온 반경이 0.068 nm이며 Ti의 이온반경이 0.061 nm로 즉 이온 반경이 큰 Ta이 치환고용 되어 격자 상수의 증가를 나타낸 것으로 사료된다.

Fig. 2는 Ta/Ti의 비율이 0.16인 시편을 600°C에서 1시간 열처리한 후 FE-SEM에 의한 표면 및 단면 관찰한 결과를 나타낸다. 표면 관찰의 결과(Fig. 2 (A)) 30 nm 정도의 grain을 갖는 것으로 나타났으며 Ta 금속의 분산된 상은 관찰되지 않았다. 이는 귀금속인 Au 및 Pt의 경우는 TiO_2 매트릭스에 분산되어 나노컴포지트를 형성하는 경우와 다르게 TiO_2 내에 고용상을 나타나는 XRD의 결과와 일치하는 경향을 나타내었다. 또한 단면 관찰의 결과를 Fig. 2(B)에 나타내고 있다. Fig. 2(B)에서 (a)부분은 기판으로 사용한 quartz galss를 나타내고 (b)부분은 Ta^{+} 도핑된 TiO_2 박막이며 화살표로 표시한 부분의 두께로부터 박막의 두께는 350 nm인 것으로 나타났다.

한편 Ta^{+} 도핑된 TiO_2 에서의 Ta 4f peak의 XPS 스

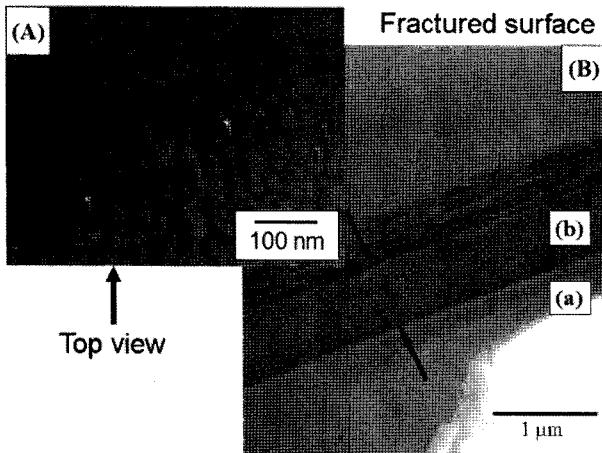


Fig. 2. FE-SEM images of (A) surface and (B) cross section of Ta-doped TiO₂ film (Ta/Ti = 0.16) heated in air at 600°C for 1 h.

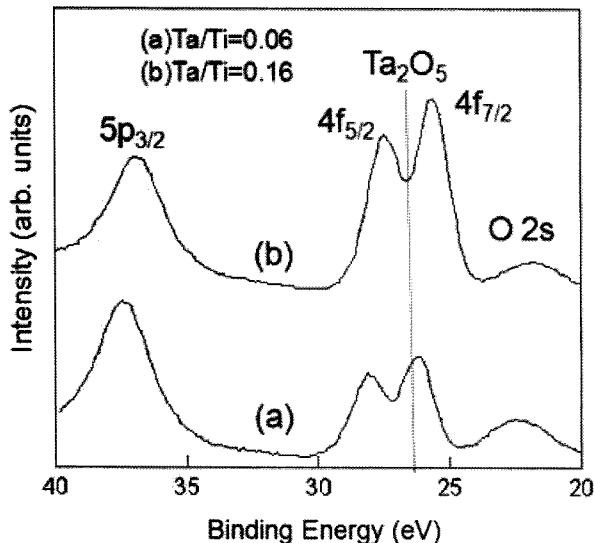


Fig. 3. XPS spectra of Ta 4f peaks from Ta-doped TiO₂ films heated in air at 600°C for 1 h.

스펙트럼으로부터 Ta 4f_{7/2} 결합에너지는 0.06의 낮은 Ta/Ti 비율을 갖는 시편에서는 26.2 eV였다. 이것은 Ta₂O₅의 경우와 거의 같다[10]. 반면에 Ta 4f_{7/2} 결합에너지는 0.16의 높은 Ta/Ti 비율을 갖는 시편에서는 25.6 eV이었다. 이것은 Ta⁵⁺로부터 약간 환원(slight reduction)된 상태를 나타내는 것으로 사료된다. 이러한 환원의 원인으로는 산소의 공격자점(vacancy)의 결과로서 일어나는 것으로 추정된다. As-deposited 박막에서 Ta 4f_{7/2} 바인딩에너지는 Ta₂O₅ 상태에 할당되고, Ta의 도핑량과는 무관한 결과를 나타내었다.

Fig. 4는 광전류 특성측정을 위한 개념도를 나타내고 있다. 광전류스펙트럼은 동시스�퍼터법에 의하여 합성된 Ta이 도핑된 TiO₂ 박막을 작업전극으로 하고 Ag/AgCl을 표준전극으로 하는 Cell에서 potentiostat(Solartron

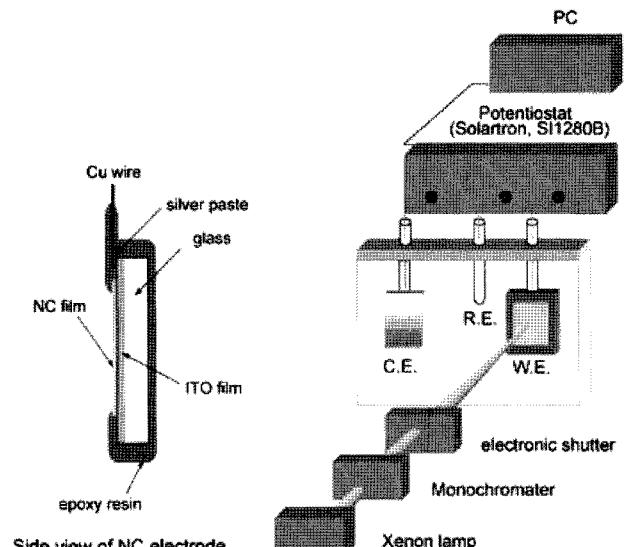


Fig. 4. Schematic diagram of photocurrent measurement using pure TiO₂ and Ta-doped TiO₂ films.

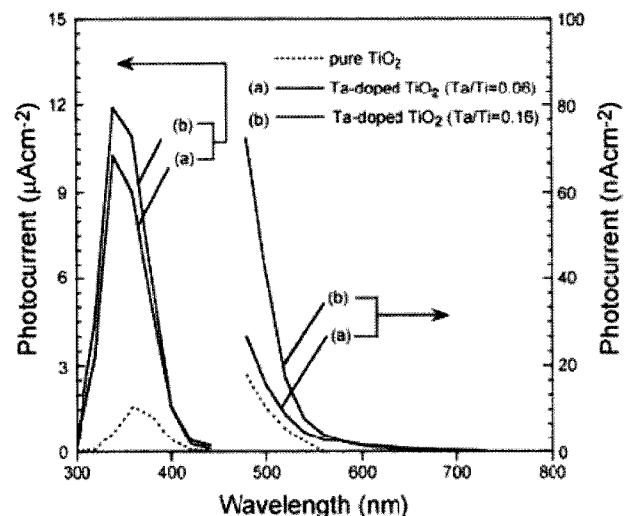


Fig. 5. Photocurrent spectra of Ta-doped TiO₂ electrode with different Ta contents. The doped films were deposited on ITO glass and heated in air at 600°C for 1 h.

SI1280B)를 가지고 측정되었다. 광원으로는 Xe 램프를 사용하였으며 단색광을 만들기 위하여 모노크로메터(Shimadzu SPG-120S)를 통과한 빛이 작업 전극샘플위에 조사 되었다. Fig. 5는 pure TiO₂ 전극의 광전류 특성(점선) 및 Ta이 도핑된 TiO₂ 전극의 광전류 특성(실선) 결과를 나타내고 있다. Ta 도핑된 TiO₂ 전극은 가시광선 영역에서도 광전류 응답을 가지고 있고 반면에 pure TiO₂ 전극은 주로 UV 범위에서 응답성을 가진다. Ta 도핑된 TiO₂ 전극의 광전류는 UV 범위에서 순수한 TiO₂의 광전류 보다 약 8배가 더 컸다. 가시광선영역에서의 Ta 도핑된 TiO₂의 광전류는 순수 TiO₂의 광전류보다 약 4배가 더크며 더욱이 720 nm 부근으로 확대되었다.

Ta이 도핑된 TiO_2 전극에 대한 가시광선 광전류의 가장 가능한 원인은 불순물 준위형성(impurity level)에 의해 발생되는 효과적인 밴드갭의 감소인 것으로 사료된다. TiO_2 격자내의 전이금속의 도핑으로 가시광선영역에서 광전류응답성 확대하기 위한 중요한 역할을 할 수 있다.

4. 결 론

Ta이 도핑된 TiO_2 박막을 quartz와 ITO glass 기판 위에 동시스퍼터법으로 제작되었다. Ta의 도핑양은 TiO_2 타겟위의 Ta 금속선의 길이에 의해 조절 될 수 있었다. Ta이 도핑된 TiO_2 박막은 고용체를 형성하였고 Ta의 도핑량 증가에 따라서 rutile에서 anatase 상으로의 구조적 변화를 일으켰다. Ta이 도핑된 TiO_2 박막을 작업전극으로 하여 광전류응답성을 측정한 결과 광전류가 자외선(UV)뿐만 아니라 가시광선(VIS) 영역에서도 관찰되었다. 이 결과는 Ta 도핑에 의하여 TiO_2 밴드갭내에 불순물 준위의 형성에 기인한 것으로 사료된다. 전이금속의 도핑과 광활성적 기반(photoactive matrix)으로서의 나노 사이즈의 새로운 금속 파티클의 분산은 새로운 산화물 광기능성 소자로의 응용가능성을 시사하였으며 자외선(UV)영역에서 보다 높은 광전류 특성의 발현 및 가시광 영역(VIS)에서의 광전류 특성의 발현은 염료감응형 태양전지의 중요한 구성요소인 산화물소재 전극으로 응용이 가능 할 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

- [1] A. Taleb, C. Petit and M.P. Pilani, "Optical properties of self-assembled 2D and 3D superlattices of silver nanoparticles", *J. Phys. Chem. B* 102 (1998) 2214.
- [2] G. Hyashi, M. Kataoka and K. Yamamoto, "Photoluminescence spectra of carbon clusters embedded in SiO_2 ", *Jpn. J. Appl. Phys. Part 2* 32 (1993) L274.
- [3] V. Joudrieri, P. Bourdon, F. Hache and C. Flytzanis, "Nonlinear light scattering in a two-component medium: Optical limiting application", *Appl. Phys. B: Lasers Opt.* 67 (1998) 627.
- [4] A. Dawson and P.V. Kamat, "Semiconductor-metal composite nanostructures. to what extent do metal nanoparticles improve the photocatalytic activity of TiO_2 films?", *J. Phys. Chem. B* 105 (2001) 11439.
- [5] A. Sobczynski, A.J. Bard, A. Campion, M.A. Fox, T. Mallouk, S.E. Webber and J.M. White, "Photoassisted hydrogen generation: platinum and cadmium sulfide supported on separate particles", *J. Phys. Chem.* 91 (1987) 3316.
- [6] J.-W. Yoon, T. Sasaki, N. Koshizaki and E. Traversa, "Preparation and characterization of M/ TiO_2 (M = Ag, Au, Pt) nanocomposite thin films", *Scripta Mater.* 44 (2001) 1865.
- [7] J.-W. Yoon, T. Sasaki and N. Koshizaki, "Photoelectrochemical behavior of Pt/ TiO_2 nanocomposite thin films prepared by pulsed laser deposition", *Appl. Surf. Sci.* 197-198 (2002) 684.
- [8] J.-W. Yoon, T. Sasaki and N. Koshizaki, "Photoelectrode properties of nanocomposite thin films based on interfacing nanosized noble metal and TiO_2 ", *Electrochim. Solid-State Lett.* 5 (2002) A256.
- [9] D. Madare, M. Tasaca, M. Delibas and G.I. Rusu, "On the structural properties and optical transmittance of TiO_2 r.f. sputtered thin film", *Appl. Surf. Sci.* 156 (2000) 200.
- [10] J.F. Moulder, W.F. Sickle, P.E. Sobole, K.D. Bomben and J. Chastain, "Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy" Perkin-Elmer, Eden Prairie, MN (1992).